⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-87522

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和64年(1989)3月31日

8/02 C 03 B 20/00

7344-4G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

60発明の名称 石英ガラスの製造方法

眀

创特 頤 昭62-246685

22出 顖 昭62(1987)9月30日

明者 四発 水 新潟県中頭城郡頸城村大字西福島28番地の1

業株式会社合成技術研究所内

秀 79発 明者 Ħ

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28番地の1 信越化学工

業株式会社合成技術研究所内

信越化学工業株式会社 の出 願 人

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

弁理士 山本 70代 理 人 亮一 外1名

1. 発明の名称

石英ガラスの製造方法

2. 特許請求の範囲

- 1.1) アルコキシシランを塩基性触媒の存在下で加 水分解して得た球状シリカ微粒子を含む溶液か ら残存する塩基性触媒を蒸留除去して液のPH を8以下としたのち、球状シリカ微粒子を沈降 させ、上澄みを除去して球状シリカ微粒子を得 る工程、
 - 2) この球状シリカ微粒子に、アルコキシシラン を融性触媒の存在下で加水分解で得た液からア ルコールおよび水を蒸留除去し、シリカ濃度を 高めた溶液を氷冷下に加え、PHを2~6に調 戦し機枠混合してシリカ微粒子を再分散させる 工程、
 - 3) この溶液から氷冷下で球状シリカ微粒子を沈 降させ、上澄み被を除去したのち昇温してゲル

化させた湿性ゲルを、乾燥、焼結、ガラス化す るて段.

とからなることを特徴とする石英ガラスの製造方

- 2. 球状シリカ微粒子を最密充填構造としたのち、 昇担しゲル化させることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載の石英ガラスの製造方法。
- 3. 湿性ゲルを石英ガラス化する工程における体積 収縮率が60%以下である特許請求の範囲第1項 または第2項記載の石英ガラスの製造方法。
- 4. アルコキシシランが珪素以外の金属アルコキシ ドもしくは金属オキシアルコキシドを含む該金属 の添加によってドーピングされたものである特許 請求の範囲第1項、第2項または第3項記載の石 英ガラスの製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は石英ガラスの製造方法、特にはシリカ ゾル被中で球状シリカ微粒子を濃縮、沈降して最 密充填構造をとらせたのち、昇温ゲル化、乾燥、

焼結ガラス化の工程で発生する割れ、発泡、不透明化を防止するようにした、ソルーゲル法によって安価にかつ歩留よく石英ガラスを製造する方法に関するものである。

(従来の技術)

しかし、この高温合成法には①酸水素火炎の燃焼熱、プラズマ発生用電力などに多大のエネルギーが必要とされるし、塑性成形時に2,000℃近くまで昇温させなければならないのでこれにも多大のエネルギーが必要とされる、②高温工程が

3年参照)、C)アルコキシシランを酸触媒また は塩基性触媒の存在下で加水分解して均一のソル を作ると共に、1 μ m 以下の微細なシリカ粒子を 水などの分散媒に隠濁した液を作り、この両者を 混合するか、あるいは上記の加水分解ゾル粧に粉 末状の微細シリカを分散処理してシリカ微粒子を 含んだシリカゾル液を作り、この P H 、温度を認 節してこれをゲル化させて湿性ゲルとし、これを 乾燥、焼結、透明ガラス化する方法(特開昭61 -91033号公報参照)などの方法が公知とさ れており、これによれば最も高温となるときでも それが1,000~1,500℃とされるので上記 した高温合成法にくらべて大巾に省エネルギー化 されるし、ドーパントの添加も各種元素のアルコ キサイドをアルコキシシランに添加し共加水分解 するか、その酸化物微細粒子を添加すればよく、 このドーパントは100%収率で固定化すること ができ、これは複散することもないという利益が 与えられ、さらにこの場合にはゲル化を所望の形 状の容器中で行なわせれば成形、切断、切削など

必要とされるために、屈折率制御のためにシリカ成長時に添加されるドーパントの固定比率が極めて低く、固定されたドーパントも塑性成形時における高温履歴過程で揮散することが多い、②製品を得るまでの工程が長いので経済性に劣る、という不利がある。

の加工操作が不要とされるので経済性にすぐれているという利点も与えられるけれども、このA)の方法にはゲルの乾燥時、焼結時に割れまたは足の力ラスが得難いたという不利があるし、B)の方法には発泡現象は生じって、が乾燥工程での割れがあるために大型のが生じっていが乾燥工程での割れがあるために大型のがなないが乾燥工程での割れがあるために大型のがあるという不利でいるというでは透明なものとなる場合で、製品も不透明なものとなる場合があり、でいるので、製品も不透明なものとなる場合が多く、透明の様成)

本発明はこのような不利を解決したゾルーゲル 法によって再現性よく、透明ガラス体を歩留りよく製造する方法に関するもので、これは①アルコキシシランを塩基性触媒の存在下で加水分解して 得た均一で一定な球形を有する球状シリカ微粒子を含む溶液から残存する塩基性触媒を蒸留除去して被のPHを8以下としたのち、球状シリカ微粒 子を沈降させ、上澄みを除去して球状シリカ微粒 子を得る工程、②この球状シリカ微粒子に、ア コキシシランを酸性触媒の存在で加水分解した 被放を高めた溶液を氷冷下に加え、PHを2~6 に翻整し、提拌混合してシリカ微粒子を再分散を は認立工程、③この溶液から氷冷下でシリカ微粒を せる工程、③この溶液から氷冷下でシリカ微粒を を最密充填構造として沈降させ、上澄み液を除去 したのち昇温してゲル化させて得た湿性ゲルを を緩、焼結、ガラス化する工程、とからなること を特徴とするものである。

すなわち、本発明者らは前記したゾルーゲル法の C) の方法を検討した結果、この方法で得られる 湿式ゲルはここに存在する微細シリカ粒子が密度の薄いもので機械的強度が弱く、焼結ガラス化時に多孔質体である乾燥ゲル表面のシラノールの脱水反応が生じ、副生する水がガラス中に閉じ込められ、その後の加熱過程で水蒸気の体積膨張によって発泡現象が生じること、また乾燥ゲル中のシリカ徴粒子群を取りまくシリカゾルから形成さ

充填構造をなすことが好ましい。一般に同じ大き さの球を最も密に積み重ねた構造を最密充填構造 というが、本発明の球状シリカ微粒子が同じ大き さの均一な単分散系よりなることから、これを濃 縮し沈殿すると該球状シリカ微粒子が最密充填構 造を成すことを確認した。

本発明ではシリカソル溶液中で球状シリカ微粒子が最密充填構造を成すことから、このソル溶液を昇温ゲル化して湿性ゲル→乾燥ゲル→焼結→ガラス化の工程における体積収縮率が従来法では8.5%以上であったものを60%以下と小さくして、それによる収縮歪が小さいために割れが生じにくい、前述の副生水蒸気等の揮散が容易なためそれい。 い、前述の副生水蒸気等の揮散が容易なためそれい。 い、前述の副生水蒸気等の揮散が容易なたれい。 なる発泡現象を防ぎ、くもりの無い透明ガラス体を再現性よく、しかも歩留りよく得ることを可能にした。

このような粒径が一定な単分散の球状シリカ微粒子のジャーナル・オブ・コロイド・アンド・インターフェイスサイエンス<u>26</u> 62 (1868) や特顧昭 61-221569 号明細書に記載され

れるシリカは粒子群よりも低温で焼結ガラス化するのでこれがガラス体中に不透明部分として散在して残ることになるということを確認し、これらの不利を解決する方法について種々検討した結果、このアンモニア等の塩基触媒による加水分解で得られるシリカ検粒子は比較的大きな口径の細気を有する為に焼結、ガラス化の際副生する水蒸気の揮散する煙道ともなっている。それ放数密度が小さいと補強効果が悪くなるとともに上述の副生水蒸気の揮散を妨げ発泡の原因となることが判明した。

一方シリカ微粒子の数密度が小さいとそれを取着くシリカゾル部がゲル化した時の不透明部分の原因となるが、数密度が大きくなるとシャープな焼結、ガラス化温度を持ち、しかも低温でガラス体が化し易く、くもりもなく均一で透明なガラス体が待られることが判った。従ってゲル化前にシリカ微粒子の数密度を出来るだけ大とする事が好ましい。

そのためにはこれ等の粒状シリカ微粒子が最密

ている方法で得られる。それによるとアンモニア、有機溶剤、水系で一定温度でアルコキシシランの加水分解を行なえばそれ等の添加量、温度を変化させることにより0.01~2.0μの範囲で粒径のコントロールが出来る。すなわち、アンモニア量を増すと粒径は大となり減ずると小にする。 水は粒径の最大を示す値があり量により変わる。 溶鉱は少ないと大、多いと小、温度は低いと大、高いと小となる。以上の条件を選ぶことにより一定の均一な粒径の球状シリカ微粒子が得られる。粒径は0.1~2.0μがよい。0.1μ以下では時間がかかり好ましくない。

本発明で用いるアルコキシシランはは式 (RO) 4Siで示され、Rは炭素数が4以上の ものとするとこれから得られるソル層が疎水性を 増して2層に分離し、均一ソル層が得られなくな るので炭素数が1~4のアルキル基であるものと されるので、これにはテトラメトキシシラン、テ トラエトキシシラン、テトラプロポキシシラン、 テトラプトキシシラン、メトキシトリエトキシシ ラン、ジメトキシジエトキシシラン、トリメトキシエトキシシランなどが例示されるが、加水分解 反応性、入手のし易さ、価格の点からはテトラメ トキシシラン、テトラエトキシシランが好ましい ものとされる。

この石英ガラスを光通信用として使用する場合には、これにドーパントを添加してその屈折率を翻弦することが必要とされる。したがって本発明の方法においてドーパントを添加する場合には、リン、チタン、アルミニウム、ポロン、ゲルマニウム、ジルコニウム、ネオジアムなどのアルコキン化合物、例えばPO(OR)。, Ti(OR)。, A1(OR)。, B(OR)。, Ge(OR)。, Zr(OR)。, Nd(OR)。 (Rは炭素数1~4のアルキル基)をアルコキンシランに所定量添加すればよく、これによれば本発明の方法が特に高温を必要としないのでドーパントが揮散することができるという有利性も与えられる。

したがって上記したの、②、③工程中で作った

プロパノール、ブタノールのような炭素数4以下 のアルコール5~100モルとの混合被を大気圧 下または加圧下に0~50℃で提搾しているとこ ろに、上記したアルコキシシラン1モルを必要に 応じ溶剤と共に滴下して行えばよいが、この機律 は生成したシリカ粒子が凝集して集合体を作らな いようにするために高い剪斯力を備えた攪拌装置 を用いて激しく提搾することがよい。この加水分 解でアルコキシシランは球状シリカ微粒子を含有 する隠濁被とされるが、このものは蒸留によって ここに残存しているアンモニア水を留去するとp Hが低下し、このpH値が8以上であると後記す る第2工程で添加される酸性加水分解均一ゾルが 瞬時にゲル化してしまうので8以下のものとする ことが必要とされる。なお、このpHを8以下と するためにはこの題濁被から水と塩基性触媒とし てのアンモニアを留去すればよく、これによれば 隠濁被は次第にSiO.濃度が増加していくが、こ れが50重量%を越えるとシリカの藍集またはゲ ル化が生じ易くなるので、SiO.が50重量%以

ものとすると、この第3工程で沈降したシリカ微粒子は最密充填構造体の数密度の高いものとなり、これを昇温してゲル化させた湿式ゲルを乾燥、焼結して得られるガラス体には割れが発生したり、発泡することがないということを見出し、これによれば透明ガラス体を再現性よく高い歩留りで得ることができることを確認して本発明を完成させた。

以下、本発明の方法をこの工程順にしたがってさらに詳細に説明する。

本発明の方法における第1工程はアルコキシシランの加水分解で均一な粒径を有する単分散のシリカ微粒子懸濁液を得る工程である。アルコキシシランまたはこれにドーパントとしての金瓜アルコキシドを必要に応じて加えたものを加水分解させるときに添加されるが、この加水分解は塩基性触媒としてのアンモニア水の。1~10モルと2~20モルの水およびアルコキシシランと相溶性のある有機溶剤、特にはメタノール、エタノール、

上になってもpHが8以下とならないときには系内に水を加えて留去を絞けることがよい。

このようにして得えられたシリカは球状であり、 均一で一定の粒径を有する単分散溶液で得られる。 これを放置するとシリカ微粒子が沈降するが粒径 が 0 、 2 μm 以下の小さい粒子は短時間では沈降し ないのでこれは遠心沈降などで沈降させることも よく、この沈降後、上澄み液を除去すればシリカ 微粒子が得られる。

本発明の第2工程はこの第1工程で得られたシリカ機粒子にアルコキンシランの酸性加水分解で作ったゾルを添加してこの最密充填構造体のシリシカ機粒子を作る工程であるが、このアルコキシシの破性加水分解は1×10~~10~ モルのない 一般酸、硫酸、硝酸などの無機酸をたは酢酸などの 無機酸のような酸性触媒と2~20モルの水が 機酸のような酸性触媒と2~20モルの 有機酸のような酸性性 とこ ールなどの 行場 谷 の がらなる 混合液を 常圧または 加圧下に 0~50 で 機 作しながら、これに前記アルコキシションまたはこれにドーパントとしての金属アルコキシ

ドを加えたもの1モルを必要に応じ添加されるく、アルコールなどの有機溶剤と共に滴下すればよく、アルコールなどを留去させてシリカ濃度を高めりカカットで作られたグリカ濃度を高めりカカットではよい。なお、これを前記した第1工程で得られたシリルコールなどを留去されてもの水、アルコールを対象には満常の単蒸発操作でも表面とれているとれているとれているとれているとれているとれているというにはいるとれているというによりがルではに近くなるので、これはできるだけによりがル化し場る発とすることがよい。

このシリカ急度を高めたゾル溶液はついでこれを上記した第1工程で得たシリカ微粒子に添加し、 規律混合するのであるが、このものは p H 値が 2 ~6の範囲のものとすることがよいので、ここに は p H 調節剤として塩酸、硫酸などの無機酸また は アンモニア水などのアルカリ性物質を適宜添加 することがよい。また、この混合攪拌は後記する ゲル化を防止するために低温で行なうことがよい ので、これは 0 ~ 2 0 ℃に保つ為に氷冷下で行なうことが必要とされる。この混合規幹によって第1 工程で得られたシリカ微粒子はこの工程で添加されるシリカゾル被と混合され、シリカ微粒子はシリカゾル被中に再分配される。

30~60℃とすることがよい。

このようにして得られた湿性ゲルはついで乾燥、 焼結することによってガラスされるが、この乾燥 は急激乾燥とすると割れを生じさせるので湿性ゲ ルに含有されている水分と残留アルコールの揮発 速度を抑えて除々に行なわせることがよく、した がってこれには開口率が0.1~5%である容器 の中で50~70℃の温度で初期湿性ゲルが15 ~35重量%になるまで乾燥させることがよい。 また、この焼箱はこの乾燥で得られた乾燥ゲルを 室温から1,100℃に段階的に昇温させること で行なえばよく、100~300℃における表面 吸着水の脱着、300~500℃のアルゴンガス 雰囲気における残留有機物の酸化、脱炭素、50 0~1,100でにおける表面シラノール基の説 水精合の間における熱量みによる割れを防止する ためには昇温速度を10~100℃/時とすれば よいが、強化中の熱伝道を良好なものとして割れ を防止するためにはこの雰囲気をヘリウムガス雰 囲気とすることがよい。なお、この焼結体中のO

H 基除去のためには700~900℃における焼結をCa。、SOCa。などのCa化剤の存在下で行なって脱OH処理すると共に、これに引続く900~1。100℃における焼結をO。ガス等の酸化剤の存在下における酸化脱Ca化処理とすることがよい。

このガラス化はこのようにして得られた焼結ケルを1,100~1,400でに段階的に昇湿して行なえばよいが、これは1,100~1,200で で細孔の閉孔を行ない、1,200~1,400でで透明ガラス化するようにすればよい。

本発明の方法による石英ガラスの製法はアルココを上記した第1~第3工程で処理することによって行なわれるが、これによればシリカ微粒子の敷密度をあられるカルででは、からの月温ゲル化で得られるのよりでは優性ゲルを乾燥、焼結、ガラス化して得られるので、対ラスは優性ゲルからの工程中の体積収縮でなながある。以下と小さく、したがって割れや発泡のない透明なものとして得られるので、石英ガラスを

安価にかつ歩切りよく生産することができるとい う工教的な有利性が与えられる。

つぎに本発明の実施例をあげるが、例中における る体積収縮率は次式で求めたものである。

(こゝに L V: 湿性ゲルの 1 辺の長さ 、 LG:石英ガラスの 1 辺の長さん

実施例1

水321g,無水エタノール4,950 ml、アンモニア水(NH、濃度28重量%)297mlの混合被を滴下ロート、温度計、タービン提件翼のついたガラス製フラスコに入れ、温度を10℃に保って激しく提作させながら、これにテトラエトキシンラン926gを滴下し、2時間提择して加水分解させたのち、これに純水を断続的に加入つつ減圧下で水、エタノール、アンモニアを留去してpHが6.5の濃度30%のシリカ脳渦被を作

たところ、このものは第1図に示したように球状 シリカ微粒子が最密充填構造をとっていることが 確認された。

ついで、これを1mの穴が閉口率で0.3%で 設けられている蓋を取り付けた恒温槽に入れる0 でに加熱してゲル化させて、同寸法のゲル体10 個を作り、この10個のゲル体を60℃の恒温槽 に移し、その温度で16日乾燥したが、ゲル体に はこの間1個の割れもなかった。つぎに、この1 0個の乾燥ゲル体をマッフル炉に入れ、室温から 300℃まで昇温速度30℃/時で昇温し、この 温度で5時間加熱したのち、成炭素処理を行いな がら300℃から700℃まで昇温速度30℃/ 時で昇温し、この温度で2時間加熱して細孔が開 いている状態で脱水縮合させ、さらにこの系内を ヘリウムガス雰囲気としてから700℃から1。 100℃まで昇温速度30℃/時で昇温し、この 温度で10時間保持し、細孔を閉孔化した。引き 続き昇温速度30℃/時で1100℃から130 0 ℃まで昇温して、この温度で5時間加熱してガ リ、ついでこれを 4,000 г р m, 20分間で 遠心分離してシリカ微粒子を沈股させたのち上窟 被を除去して粒径が 0.2 μ m である均一な球状シ リカ微粒子を作った。

他方、テトラエトキシシラン260gと、無水 エタノール103世とからなる混合液を25℃に 保ち、これに激しく攪拌しながら0.02規定の 塩酸水90gを加え、2時間攪拌して加水分解さ せたのち、これを減圧下に、40~50℃に加熱 して水およびエタノールを留去しシリカ濃度が3 0 重量%であるシリカゾル液を作り、これを上記 で得たシリカ検粒子に添加し、激しく提拌してシ リカ微粒子を再分散したのち、氷冷下で激しく提 **押しつつアンモニア水を添加してそのpHを5に** 副整し、これを160×160×50mmのテフロ ン製容器に入れ、氷冷下に一昼夜放回してシリカ 微粒子を沈降させたのちスポイトで上澄液を除去 してから得られたものについてスーパープローブ マイクロアナライザーJCXA733〔日本電子 (株)製商品名)を用いて電子顕微鏡写真を撮影し

ラス化したところ、120×120×10 mmの大きさの透明な石英ガラス体10個が得られた、このときの湿性ゲルからガラス体への体積収縮率は58%であった。

実施例2

実施例1におけるテトラエトキシシラン926 gをテトラエトキシシラン880gとリン酸トリ メチル31gの混合物としたほかは実施例1と同様に処理してテトラエトキシシランの塩基性触媒 存在下での加水分解、沈降、上澄被除去を行なっ て平均粒径が、0・2μmのリンでドープされた シリカ微粒子を作った。

また、実施例1におけるテトラエトキシシラン247260gの代わりにテトラエトキシシラン247gとリン酸トリメチル((CH,)O),PO8.8gとの混合物を使用したほかは実施例1と同様に処理してテトラエトキシシランの酸性触媒存在下での加水分解、水、エタノール除去を行なってリンでドープされたシリカ濃度30重量%のシリカゾル液を作った。

特開昭64-87522(7)

つぎにこのシリカ微粒子とシリカゾル液とを実施例1と同様の方法で混合し、再分散、沈降し、上澄みを除去し、昇温ゲル化して湿性ゲルを作り、これを乾燥、焼結、ガラス化したところ、この体積収縮率は58%でこの場合にも割れ、発泡なしでリンでドープされた石英ガラス10個が得られ、このときのリンの固定率はほど100%であった。比較例1

水209g, 無水エタノール3, 228 mm、28 重量%のアニンモニア水194 mmの混合物を実施例1で使用したガラス製フラスコに入れ、これにテトラエトキシンラン604gを滴下し、2時間提拌して加水分解させたのち、これに純水を断続的に加えつつ減圧下に水、エタノール、アンモニアを留去してpHが6.5になるまで濃縮し、平均粒径が0.16 mでシリカ濃度が30重量%のシリカ微粒子感濁液を作った。

他方、テトラエトキシシラン494g、無水エタノール196㎡の混合物を実施例1で使用したガラス製フラスコに入れ、0.02規定の塩酸水

で1個は割れ、1個は発泡を含むものであり、このときの湿性ゲルからガラス体への体積収縮率は89%であった。

4. 図面の簡単な説明

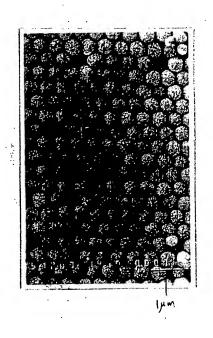
第1回は実施例1で得られたゲル化前の球状シリカ微粒子の電子顕微鏡写真、第2回は同じく比較例で得られた球状シリカ微粒子の電子顕微鏡写真を示したものである。

171gを加え、2時間提搾して加水分解させて シリカゾル液を作り、これを上記したシリカ微粒 子脳濁液と混合したのちアンモニア水を加えて p H5.0 に調整したものについて実施例と同じ電 子顕微鏡写真を撮影したところ、これは第2回に 示したように球状シリカ微粒子の各粒子がバラバ ラとなっており、最密充填構造となっていないこ とが判った。

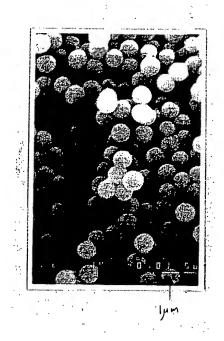
ついで、250×250×50mのテフロン製 容器に入れ、これを1mの穴が関口率0.3%と されている蓋を取りつけた30℃の恒温槽に入れ てゲル化させて同寸法の湿式ゲル体10個を作り、 このゲル体10個を60℃の恒温槽に移し、その 温度で16日間乾燥して乾燥ゲルとしたところ、 このものは10個のうち2個に割れが生じていた。

つぎにこの残りの8個のゲル体について実施例1と同じ方法で焼結、ガラス化したところ、このうちの4個は120×120×10mmの透明ガラス体となったが、残り4個のうちの2個は不透明

第 1 図



第 2 図



手統補正費

昭和62年11月 9日

特許庁長官 小川 邦夫 顕



1.事件の表示

昭和62年特許顧第246685号

2. 発明の名称

石英ガラスの製造方法

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人 名称 (206)信越化学工業株式会社

4. 代理人

5. 補正命令の日付

自免

6. 福正の対象

明細書における「発明の詳細な説明の個」

7. 補正の内容

- 1) 明細書第14頁12行~13行の「この最密充填構造体のシリカ微粒子を作る工程」を「このゾル中でシリカ微粒子を再分散させる工程」と補正する。
- 2) 明細書第15頁19行の「後記する」を削除する。
- 3) 明細書第16頁5行の「再分配」を「再分散」と補正する。
- 4) 明細書第19頁5行の

「体積収縮率= $\frac{(LV^3-LG^3)}{LV}$ × 100」を 「体積収縮率= $\frac{(LV^3-LG^3)}{LV}$ × 100(%) と補正する。

以上